

【SP-07】

Depth profile 측정 시에 영향을 주는 Sputtering rate에 관한 연구

김주광, 성인복, 강석태
연세대학교 물리학과

이온 주입기술은 이온을 시료의 표면에 조사시켜 표면에 개질된 층을 만드는 표면개질 기술이며, 이 경우에 주입된 이온의 깊이 방향 분포를 정확히 아는 것이 중요하다. 본 연구에서는 depth profile 측정 시에 나타나는 sputtering rate의 변화를 SRIM simulation을 이용하여 계산하고, 그 변화가 depth profile에 영향을 주는 것을 확인하였다.